

調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
<p>[17] ベンゾ[a]ピレン</p>	<p>【水質】</p> <p>水質試料 約1L アセトン 5.0mL (瓶内洗浄)</p> <p>サロゲート物質添加 ベンゾ[a]ピレン-d₁₂ 20ng</p> <p>攪拌・振とう抽出 攪拌 30分間 ヘキサン 2.0mL添加 攪拌 30分間 振とう 1分間 ヘキサン層 1.0mL分取</p> <p>GC/MS-SIM-EI又はGC/HRMS-SIM-EI</p> <p>「平成29年度化学物質分析法開発調査報告書」 準拠</p>	<p>分析原理：GC/MS-SIM-EI又はGC/HRMS-SIM-EI</p> <p>検出下限値： 【水質】 (ng/L) [17] 0.086</p> <p>分析条件： 機器 GC：Agilent 7890A MS：Agilent 5975C 又は GC：Agilent 6890 MS：Waters AutoSpec Ultima 他 カラム Agilent J&W DB-17ms 30m×0.25mm、0.25μm 又は Agilent Select PAH 30m×0.25mm、0.25μm 他</p>

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
<p>[17] ベンゾ[a]ピレン</p>	<p>【底質】</p> <pre> graph TD A["底質試料 湿泥 20g-wet程度 (乾泥10g-dry相当) ハイドロマトリックス 13g 還元銅 5g サロゲート物質添加 ベンゾ[a]ピレン-¹³C₄ 80ng"] --> B["高速溶媒抽出 アセトン/ヘキサン(50:50) 100℃、1500psi ×3回"] B --> C["希釈 精製水 300mL 塩化ナトリウム 15g"] C --> D["振とう抽出 振とう 10分間 静置 10分間"] D --> E["ヘキサン層"] D --> F["残差"] E --> G["振とう抽出 ヘキサン 50mL 振とう 10分間 静置 10分間"] G --> H["脱水 無水硫酸ナトリウム"] F --> H H --> I["濃縮 ロータリーエバポレータ 3~4mLまで"] I --> J["定容 ヘキサン 4mL"] J --> K["分取 1mL"] K --> L["カラムクリーンアップ Sep-Pal Silica 6cc Vac, 2g 妨害物質除去：ヘキサン 8mL 溶出：ジクロロメタン/ヘキサン(5:95) 15mL"] L --> M["濃縮 ロータリーエバポレータ 窒素パージ 0.5~1mLまで"] M --> N["定容 ヘキサン 1mL"] N --> O["GC/HRMS-SIM-EI"] </pre> <p>「平成29年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠</p>	<p>分析原理：GC/HRMS-SIM-EI</p> <p>検出下限値： 【底質】 (ng/g-dry) [17] 0.19</p> <p>分析条件： 機器 GC：Agilent 6890H MS：JEOL JMS-800D 又は GC：Agilent 6890 MS：Waters AutoSpec Ultima カラム Agilent J&W DB-EUPAH 20m×0.18mm、0.14μm 又は Agilent Select PAH 30m×0.25mm、0.25μm</p>